

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[10]2,6-ジニトロトルエン [11] <i>m</i> -ジニトロベンゼン [17] <i>o</i> -ニトロアニリン [18] <i>m</i> -ニトロアニリン	<p>【底質】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>底質試料 湿泥 (乾泥換算約10g)</p> <p>抽出 アセトン 40mL 振とう 10分間 超音波 10分間</p> <p>遠心分離 2,000rpm、10分間</p> <p style="text-align: center;">2回繰り返す</p> </div> <p>クリーンアップスpike添加 2,6-ジニトロトルエン-d₃ 50ng <i>m</i>-ジニトロベンゼン-d₄ 50ng <i>o</i>-ニトロアニリン-d₄ 50ng <i>m</i>-ニトロアニリン-d₄ 50ng</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>希釈 5%塩化ナトリウム水溶液 500mL</p> <p>振とう抽出 ジクロロメタン 50mL、10分×2回</p> <p>洗浄 精製水 50mL</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>希釈 ヘキサン 50mL</p> <p>脱水 無水硫酸ナトリウム</p> <p>濃縮 ロータリーエバポレータ 窒素バージ 1mLまで</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>カラムクリーンアップ 5%含水シリカゲル 5g 妨害物質除去:ジクロロメタン/ヘキサン(10:90) 50mL 溶出:アセトン/ヘキサン(10:90) 40mL</p> <p>濃縮 窒素バージ 0.5mL未満まで</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>定容 ヘキサン 0.5mL</p> <p>GC/MS-SIM-EI</p> </div> <p>注) GC/MS-SIM-EIに換え、GC/MS-NCIで実施された例があった。 「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」準拠</p>	<p>分析原理：GC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【底質】 (ng/g-dry) [10] 0.10 [11] 0.11 [17] 0.10 [18] 0.22</p> <p>分析条件： 機器 GC：HP6890 MS：HP5973MSD カラム BPX35 30m×0.25mm、0.25μm</p>

調査対象物質	分析法フローチャート	備考
[16]o-ニトロアニソール [17]o-ニトロアニリン	<p>【大気】</p> <pre> graph TD A[大気] --> B[捕集 Sep-Pak PS-AIR 5L/分×24時間] B --> C[溶出 アセトニトリル 10mL] C --> D[濃縮 窒素パージ 1mLまで] D --> E[カラムクリーンアップ Sep-Pak Plus Silica 溶出：ヘキサン 5mL、ジクロロメタン/ヘキサン(50:50) 5mL] E --> F[希釈 精製水 0.5mL] F --> G[抽出 ヘキサン 0.5mL×2回] G --> H[↑ シリシメス[®]イ[®]添加 フェナントレン-d₁₀ 100ng] H --> I[定容 ヘキサン 1mL] I --> J[GC/MS-SIM-EI] </pre> <p>注) 溶出において、バックフラッシュ法によりアセトニトリル6mLで実施された例があった。</p> <p>「平成19年度化学物質分析法開発調査報告書」 準拠</p>	<p>分析原理：GC/MS-SIM-EI</p> <p>検出下限値： 【大気】 (ng/m³) [16] 1.4 [17] 0.32</p> <p>分析条件： 機器 GC：HP6890 MS：HP5973MSD カラム DB-5MS又はVF-5ms 25m×0.25mm、0.25μm 若しくはHP-5MS 30m×0.25mm、0.25μm</p>